電子線照射発光活性化液体窒素温度 PL 法による P添加n型CZ-Si結晶の炭素定量

Determination of Carbon Concentration in Phosphorus doped n-type CZ-Si Crystals by Liquid-Nitrogen-Temperature Photoluminescence after Electron Irradiation

明治大理工1,九州大工2 〇石川 陽一郎1,田島 道夫1,木内 広達1,小椋 厚志1,

宮村 佳児², 原田 博文², 柿本 浩一²

Meiji Univ.¹, Kyushu Univ.² ^oYoichiro Ishikawa¹, Michio Tajima¹, Hirotatsu Kiuchi¹, Atsushi Ogura¹, Keiji Miyamura², Hirofumi Harada², Koichi Kakimoto²

E-mail: ce171006@meiji.ac.jp

Si 結晶中の微量炭素定量法として、電子線照射によ 【序】 って誘起された欠陥に起因する C-line (Ci-Oi), G-line (Ci-Cs)の フォトルミネッセンス(PL)を利用する手法が注目されてい る¹⁾. 本研究では液体ヘリウム温度(4.2 K)測定に比べて, 様々な利点を持つ液体窒素温度(77K)測定²⁾を行い,4.2K測 定および FT-IR 測定結果と比較することから、77 K PL 測定 法による定量値の妥当性,信頼性を検証した.

【実験方法】 測定試料は3本のP添加n型CZ-Si結晶イン ゴット(L, M, N)の固化率gの異なる部位から切り出した. インゴットL, M, Nとも炭素濃度は<2×10¹⁵-8.0×10¹⁵ cm⁻³ (FT-IR 測定)の範囲にあり,酸素濃度は 9×10¹⁷ cm⁻³ 前後(FT-IR 測 定, IOC-88) である. インゴットトップ側の抵抗率は L, M が 50 Ω·cm 程度, N が 1 Ω·cm 程度である. これらの試料に対 し, 電子線照射後 (加速電圧:2 MeV, 照射線量:1.0×10¹⁵ cm⁻ ²) に, DPSS レーザー照射下 (波長:532 nm, ビーム径:約 2.3 mm, 試料面上強度:約 50 mW (4.2 K), 190 mW (77 K)) で,PLを測定した.

【結果と考察】 炭素濃度が同程度 (≈2×10¹⁵ cm⁻³)で,抵抗 率が異なる試料 M6, N1 の 77 K における PL スペクトルを Fig.1 に示す. 4.2 K 測定では2 試料でバンド端近傍発光が大 きく異なっていたが、77 K ではほぼ同様のスペクトル形状 である.

各試料の G-line の強度比の炭素濃度依存性を Fig. 2 に示 す. ここで, (a) 4.2 K においては P 不純物束縛励起子線 PTO, (b) 77 K においてはバンド端発光 ITO に対する G-line の相対 強度をプロットしている.4.2K では,L, M と N で抵抗率(P 濃度)が異なることに対応して 2 つの正相関関係(検量線) に分かれたが、77Kでは抵抗率の相違によらず1つの正相 関関係で表すことができた.その理由として 77 K では, 4.2 K で観測された不純物束縛励起子系ならびに電子正孔液滴 発光が消滅し、バンド端発光 Iroのみとなる発光過程の単純 化²⁾ が挙げられる. なお C-line と G-line を比較すると, 今回 の試料の酸素濃度領域では、G-line が十分な強度で観測され たこと、および C-line の強度比はばらつきが多くなることか ら、定量には G-line の強度比を利用した.

Fig.3に4.2K および77K における G-line の強度比から推 定した炭素濃度およびFT-IR による炭素濃度の固化率依存性 を示す. 実線は偏析曲線 (Scheil's law) による外挿であり, 3濃度値は比較的良い一致を見せている. なお,77K推定値 は他と比較してややずれが大きく、今後の課題である.

以上より電子線照射発光活性化液体窒素温度 PL 法は, 4.2 K 測定と比較し、ほぼ同様の精度で定量が行え、抵抗率の影 響を受けにくいという大きな特長があることが実証された.

【謝辞】本研究の一部は経済産業省のもと、NEDO から委託され、実 施したもので関係各位に感謝致します.

1) 中川聰子:応用物理,84,976 (2015).

2) M. Tajima et al.: Appl. Phys. Express, 10, 046602 (2017).



Fig. 1. PL spectra at 77 K of Si with the same C concentration of $\approx 2 \times 10^{15}$ cm⁻³ and with different ρ of (N1) 1.4 and (M6) 39 Ω ·cm.



Fig. 3. Variation of C concentration along g determined by FT-IR and by PL at 4.2 and 77 K.

a

Тор

FT-IR D. L.

→ Tail